K-39

電子ビームの大電流化を目的とした PFN 回路を用いたホローカソード放電の形成 Formation of Hollow Cathode Discharge Using PFN Circuit for High Current Electron Beam

○長瀬敦¹, 中村輝², 渡部政行³, 田辺光昭⁴ *Atsushi Nagase¹, Hikaru Nakamura¹, Masayuki Watanabe³, Mitsuaki Tanabe⁴

Abstract: General electron beam sources use thermionic emission as the electron source. Since thermions are generated by heated metals, the part of metal is severely damaged by heat, and durability becomes low. To solve thermal problems of such electron sources, the purpose of this research is to develop an electron beam source by using electrons in the plasma as a source. In our electron beam device, the hollow cathode discharge is applied to the electron source of the electron beam. Hollow cathode discharge can produce a high density plasma. In this experiment, the discharge is formed by a PFN circuit for the extension of the plasma discharge time. By using a 5-stage PFN circuit, it was confirmed that the discharge time was about 5 times longer than that of a single stage circuit.

1. 研究背景および目的

荷電粒子ビームとは、生成した電子やイオン等の荷 電粒子を電場や磁場を用いて加速・収束し、それらの軌 道を任意に制限できるようビーム状にしたものである。 荷電粒子は比較的容易に生成できる粒子であり、質量 が小さく、微小であるため高速で制御性もよい.以上 の理由から、電子ビームやイオンビーム等の荷電粒子 ビームは、様々な研究や医療・工学分野で応用されて きた.現代では電子顕微鏡や半導体、加速器など物質 の加工や測定技術などさまざまな研究分野に利用され ている^[1].

本研究室ではプラズマ放電中の電子を利用した電子 ビーム源の研究を行っている.電子ビームは電子を生 成し、 生成された電子を任意の軌道に制御する装置で ある. 電子の生成において、これまでの一般的な電子 ビーム源では、フィラメントなどの金属を加熱するこ とにより電子が放出される熱電子放出を利用して電子 の供給源としてきた[2].しかし、金属加熱による熱電子 放出では大量の電子を発生することは難しく、さらに 金属過熱により金属を破損してしまうことから定期的 な金属交換などのメンテナンスが必要となる. そこで, プラズマ放電中の電子を電子ビーム供給源とすること で耐久性が高く、大電流化の可能な電子ビーム源の実 現を目指している.特に本研究ではホローカソードの 放電に Pulse Forming Network (PFN) 回路のパルス放電 を用いることで多量の電子を生成し、それを電子ビー ム源として利用する研究を行っている.

2. ホローカソード放電

Figure 1 にホローカソード放電の概略図を示す.ホ ローカソード放電とは通常のグロー放電のカソードに おいて中空円筒状の電極を用いることにより通常より 多くの電子を生成する放電である.通常のグロー放電 は2枚の平行平板電極間に1~100Pa 程度の気体を充満 させ,電極間に印加する電圧を増加していくと,気体 が電離し,電流が流れる現象である.これは電極間に 存在するイオンがカソードに衝突することにより電極 表面から電子が飛び出るγ作用とカソードから飛び出 た電子が気体分子に衝突することで気体分子を電離さ せるα作用が連鎖的に起こることで放電の形態を維持 している.ホローカソードを放電に用いることで広い 陰極表面におけるγ作用により生成された電子がホロ ーカソード内を往復運動しそれが気体分子に衝突する ことで平行平板電極を使う放電と比べ,より多くの電 子を生成することができる.



Figure 1. Schematic drawing of hollow cathode discharge

3. PFN 回路

PFN 回路の回路図を Figure 2 に示す. PFN 回路とは 通常のパルス的な電圧を印加し,大電流を形成する際 に用いられるコンデンサーの放電において,充電され たコンデンサーとコイルを電圧を印加する対象に対し, 複数個並列に多段に接続することで通常過渡的な応答

1:日大理工・学部・航宇 2:日大理工・院(後)・量子 3:日大・教員・量科研 4:日大・教員・航宇

になるコンデンサーの放電の時間応答の幅を長くして, 放電波形を矩形波に近づけるものである^[3].本実験に おいては電気容量16µFのコンデンサー,インダクタン ス1.7µHのコイルを5個並列に接続し,放電実験を行っ た.回路の特性インピーダンス $\sqrt{L/C}$ と等しい0.33 Ω の 抵抗を用いてシミュレーションを行った結果を Figure 3に示す.シミュレーションには LTspice XVIIを使用し た.PFN 回路を用いた回路においてパルス幅τはτ = 2n \sqrt{LC} となる.コンデンサーが1個の場合 (n=1)に比 べ,5段の PFN 回路 (n=5) では放電波形が約5倍,伸 びていることが確認できる.



Figure 2. Schematic drawing of PFN circuit



Figure 3. Simulation results of PFN circuit

4. 実験装置および結果

放電実験では、ホローカソード-アノード間に電圧 を印加した状態でホローカソード内に気体を流入さ せ、パルス放電を形成させる.実験装置の概略図と回 路図を Figure 4 に示す.コンデンサーに充電する電圧 を 100V から 1,000V まで、100V ずつ増加させたとこ ろ、充電電圧が 500V で放電が発生した.またパルス 放電が形成された様子を測定することができた.ホロ ーカソード-アノード間の電圧と電極間に流れた放電 電流の時間応答を Figure 5 に示す.放電実験の結果よ りホローカソード-アノード間で放電を形成した場合 でもシミュレーションの結果とほぼ同じ時間幅の放電 波形を確認することができた.しかし、電圧や電流の 最大値や収束値などがシミュレーションと異なる結果 になった.これは気体が放電しプラズマが形成されて いるが,プラズマの抵抗成分やインダクタンス成分が 一定ではなく,時間とともに変化するためであると考 えられる.

ホローカソード-アノード間の PFN 回路を用いての 放電は確認できたので、この PFN 回路を用いた放電 で生成した電子を電子ビームとして制御できるのかを 検討する実験を進めていく.その結果および検討につ いては講演会にて発表する.



Figure 4. Schematic drawing of experimental equipment



Figure 5. Time response of discharge voltage and current of the hollow cathode discharge using PFN circuit

5. 参考文献

[1] 石川順三: 荷電粒子ビーム工学, コロナ社, 2001, pp.1-8, 237-268

[2] Koichi Saeki: "Hot cathode discharge plasmas", J. Plasma Fusion Res, Vol.79, No.12, pp1242-1248, 2003

[3] 高木浩一,他:「パルスパワー発生回路の設計と実践」,J. Plasma Fusion Res, Vol87, No.3, pp202-215, 2011
[4] Sofia del Pozo et.al: "A Novel RF Excited Plasma Cathode Electron Beam Gun Design", IEEE Transactions on

Electron Devices, Vol.61, No.6, pp1890-1894, 2014